

世界のエネルギー問題を解決する新しいパワー半導体(GeO_2 半導体)を用いた Phantom SVD 法による成膜技術

自社のコア技術と強み、アピールポイント

■ GeO_2 半導体は低損失、小型化、高耐圧化を可能とする三拍子揃った新しい半導体です。

低損失

- ・エネルギー損失を大幅に削減

小型化

- ・装置を劇的に小型化

高耐圧化

- ・高耐圧・高出力市場を創出

既存技術では到達不可能な新規市場



超高耐圧、
高出力市場の創出



放射線耐性が必要な宇宙用用途、
原子力発電用途



■ Phantom SVD 法による成膜技術

- ・金属酸化物膜
- ・金属膜
- ・金属硫化膜等も可能(窒化物、炭化物は苦手)
- ・有機膜(ポリマーも可能)

自社技術の適用例

■ 今後応用可能な分野について

- ・EV やデータセンターなどより効率の良い GeO_2 を用いることで、航続距離が伸びたり、熱処理の問題を解決できる。